

平成 15 年 6 月 12 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 梅野正隆

日本学術振興会『結晶加工と評価技術』第 145 委員会
第 96 回研究会開催通知

1. 日時：平成 15 年 7 月 11 日(金)午後 1 時より 5 時まで
2. 会場：主婦会館地下 2 階クラルデ(東京都千代田区六番町 15 番地、TEL.03-3265-8111、JR 中央線四ツ谷駅麹町口正面)
3. 研究会
テーマ：『シリコンの微小欠陥の評価法の標準化に向けて』
世話人：井上直久(大阪府立大学)

13:00～13:15 委員総会

講演

13:15～13:50

(1) 光散乱法に関する規格について

三菱住友シリコン(株) 宮崎守正

13:50～14:25

(2) 光散乱法によるシリコン基板の欠陥の評価

東芝セラミックス(株) 鹿島一日兒

14:25～15:00

(3) 光散乱トモグラフィーの開発と課題

三井金属鉱業 守矢一男

15:00～15:15 休憩

15:15～15:50

(4) 光散乱法による欠陥計測

ラトックシステムエンジニアリング 南郷脩史、結晶工学研究会 小川智哉

15:50～16:25

(5) 光散乱トモグラフィーの原理と応用

熊本県立技術短期大学校 坂井一文、結晶工学研究会 小川智哉

16:25～17:00

(6) ドライエッチングによる微小欠陥の評価

豊田中研 中嶋健次、吉田友幸、光嶋康一

出欠のご返事は同封の出欠回答 FAX 用紙にて 7 月 3 日(木)までをお願い致します。